ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАНОАМПЕРНОГО ДИАПАЗОНА В СКАНИРУЮЩЕМ ТУННЕЛЬНОМ МИКРОСКОПЕ

Д. П. Михалевич

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь

Научный руководитель Ю. А. Козусев

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) – первый из семейства зондовых микроскопов – был изобретен в 1981 г. швейцарскими учеными Г. Биннигом и Г. Рорером. В своих работах они показали, что это достаточно простой и весьма эффективный способ исследования поверхности с пространственным разрешением вплоть до атомарного. В настоящее время зондовая микроскопия – это бурно развивающаяся область техники и прикладных научных исследований.

Принцип работы СТМ основан на явлении туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер в виде непроводящего вакуумного зазора между металлическим зондом и проводящим образцом во внешнем электрическом поле.



Puc. 1. Схема туннелирования электронов через потенциальный барьер в туннельном микроскопе

При подведении зонда к поверхности образца на расстояния в несколько ангстрем образуется туннельно-прозрачный потенциальный барьер, величина которого определяется, в основном, значениями работы выхода электронов из материала зонда и образца. При качественном рассмотрении барьер можно считать прямоугольным с эффективной высотой, равной средней работе выхода материалов ф.

Экспоненциальная зависимость туннельного тока от расстояния позволяет осуществлять регулирование расстояния между зондо и образцом в туннельном микроскопе с очень высокой точностью. На этом основан принцип работы СТМ, который представляет собой электромеханическую систему с отрицательной обратной связью. Система обратной связи поддерживает величину туннельного тока между зондом и образцом на заданном уровне, выбираемом оператором. Поддержание заданной величины туннельного тока осуществляется за счет изменения размера пьезокерамики в вертикальном направлении (а следовательно, перемещения зонда микроскопа вдоль оси Z) в соответствие с рельефом поверхности. Зондом служит тонкое металлическое острие, смонтированное на электромеханическом приводе (X, Y, Z – позиционере). Когда такое острие подводится к участку исследуемой поверхности на расстояние ≤ 10 Å, то при приложении между острием и образцом небольшого (от 0,01 до 10 В) напряжения смещения Vs через вакуумный промежуток ΔZ начинает протекать туннельный ток I_0 порядка 10^{-9} А. Полагая, что электронные состояния (орбитали) локализованы на каждом атомном участке, при сканировании поверхности образца в направлении Х и/или У с одновременным измерением выходного сигнала в цепи Z можно получить картину поверхностной структуры на томном уровне. Эта структура может быть отображена в двух режимах. В режиме постоянного туннельного тока (рис. 2, а) зонд перемещается вдоль поверхности, осуществляя растровое сканирование; при этом изменение напряжения на Z-электроде пьезоэлемента в цепи обратной связи (с большой точностью повторяющее рельеф поверхности образца) записывается в память компьютера в виде функции Z = f(x, y), а затем воспроизводится средствами компьютерной графики.

При исследовании атомарно гладких поверхностей часто более эффективным оказывается получение СТМ изображения поверхности в режиме постоянной высоты Z = const. В этом случае зонд перемещается над поверхностью на расстоянии нескольких ангстрем, при этом изменения туннельного тока регистрируются в качестве СТМ изображения поверхности (рис. 2, δ). Сканирование производится либо при отключенной ОС, либо со скоростями, превышающими скорость реакции ОС, так что ОС отрабатывает только плавные изменения рельефа поверхности. В данном способе реализуются очень высокие скорости сканирования и высокая частота получения СТМ изображений, что позволяет вести наблюдение за изменениями, происходящими на поверхности, практически в реальном времени.



Рис. 2. Формирование СТМ изображений поверхности по методу постоянного туннельного тока (*a*) и постоянного среднего расстояния (*б*)

Схема системы управления СТМ представлена на рис. 3. Напряжение на туннельном промежутке задается оператором с помощью ЦАП-U, а поддерживаемый системой обратной связи ток – с помощью ЦАП-I. Двухканальные цифроаналоговые преобразователи ЦАП-Х и ЦАП-У служат для формирования строчных и кадровых разверток. Петля обратной связи состоит из предварительного усилителя ПУ, конструктивно расположенного в измерительной головке СТМ, разностного усилителя РУ, фильтра низких частот ФНЧ, усилителей У4 и У5, пьезопреобразователя, регулирующего величинутуннельного промежутка.

В начальном состоянии ток в петле обратной связи отсутствует, и сканер максимально вытянут в направлении к образцу. При появлении туннельного тока обратная связь отодвигает сканер, и система переходит в режим точной установки образца. В этом режиме происходит совместное движение образца и отодвигание (системой ОС) зонда до тех пор, пока сканер не встанет в середину своего динамического диапазона. При этом в петле обратной связи поддерживается постоянным выбранное оператором значение туннельного тока. Сканирование образца осуществляется при подаче напряжений пилообразной формы на внешние электроды трубчатого сканера с помощью двухканальных ЦАП-Х и ЦАП-У и двухканальных высоковольтных усилителей У1 и У2. При сканировании система обратной связи поддерживает постоянным туннельный ток. Это происходит следующим образом. Реальное мгновенное значение туннельного тока I_t сравнивается на разностном усилителе со значением I_0 , заданным оператором. Разностный сигнал ($I_t - I_0$) усиливается (усилителями У4 и У5) и подается на внутренний Z-электрод сканера. Таким образом, при сканировании напряжение на Z-электроде сканера оказывается пропорциональным рельефу поверхности. Сигнал с выхода усилителя У4 записывается с помощью АЦП как информация о рельефе поверхности.



Рис. 3. Схема системы управления сканирующего туннельного микроскопа

Предварительный усилитель выполнен на прецизионном операционном усилителе OPA128 с основными параметрами, представленными в таблице.

Параметры ОУ при U _{пит} = ±15 В и R _н ≥ 2 кОм	OPA128KM			Единицы
	мин.	тип.	макс.	измерения
Напряжение питания	±5	±15	±18	В
Входной ток смещения		±75	±150	фА
Разность входных токов		30		фА
Напряжение смещения нуля		±140	±500	мкВ
Тепловой дрейф			±10	мкВ/°С
Скорость нарастания выходного сигнала		3		В/мкс
Входное сопротивление		10 ¹³		Ом
Коэффициент усиления сигнала	110	128		дБ
Коэффициент ослабления синфазного				
сигнала	90	118		дБ
Выходное напряжение	±10	±13		В
Выходной ток	±5	±10		мА
Выходное сопротивление		100		Ом

Схемная реализация ПУ представлена на рис. 4.

Литература

- 92. G. Binnig, H. Rohrer. Scanning tunneling microscopy IBM Journal of Research and Development 30,4 (1986).
- 93. A. Bonnell and B. D. Huey. Basic principles of scanning probe microscopy from Scanning probe microscopy and spectroscopy: Theory, techniques, and applications 2nd edition Ed. By D. A. Bonnell Wiley-VCH, Inc. New York (2001).